世界知的所有烯糊即 国際事務局 条約に基づいて公開された国际出願



(51) 国際特許分類6 WO99/32497 (11) 国際公開番号 A1 C07F 9/6561 * 1999年7月1日(01.07.99) (43) 国際公開日

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/05709

(22) 国際出願日

1998年12月17日(17.12.98)

(74) 代理人

弁理士 朝日奈忠夫, 外(ASAHINA, Tadao et al.)

〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目17番85号 武田薬品工業株式会社 大阪工場内 Osaka, (JP)

SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, US, UZ, VN. YU. ARIPO特

許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許

(AM. AZ. BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT. BE.

(30) 優先権データ

特願平9/351499

1997年12月19日(19.12.97)

(81) 指定国 AL, AM, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CN. CU. CZ, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KG, KR, KZ, LC. LK, LR, LT, LV, MD, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, RU,

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 武田塞品工業株式会社

(TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP] 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号 Osaka, (JP)

(72) 発明者:および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

石川智康(ISHIKAWA, Tomoyasu)IJP/JP1 〒520-0052 滋賀県大津市朝日が斤2丁目4番18号

Shiga, (JP) 橋口昌平(HASHIGUCHI, Shohei)[JP/JP]

〒560-0881 大阪府豊中市中桜塚1丁目10番17号 Osaka, (JP)

飯源結中(IJZAWA Yuii)[JP/JP] 〒617-0003 京都府向日市森本町上町田13番地5-403 Kyoto, (JP)

CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE. SN. TD. TG).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: PHOSPHONOCEPHEM DERIVATIVES, PROCESS FOR THE PREPARATION OF THE SAME, AND USE THEREOF

(54)発明の名称 ホスフォノセフェム誘導体、その製造法および用途

(57) Abstract

Novel cephem compounds excellent in antimicrobial activity, stability and peroral absorbability, which are compounds represented by general formula (I) or esters thereof or salts of the esters; a process for the preparation of them; and drugs containing them. In said formula, R¹ is phosphono or a group convertible into phosphono; R² is hydrogen or a group bonded to the oxygen atom through a carbon atom; Q and X are each nitrogen or CH; Y is S, O or CH2; n is 0 or 1; and either of R3 and R4 is an optionally substituted pyridinium group and the other is hydrogen or an optionally substituted hydrocarbon group, or alternatively R3 and R4 may be united to form an optionally substituted heterocyclic group having a quaternary nitrogen atom.

優れた抗菌作用、安定性、経口吸収性を有する式

〔式中、 R^1 はホスフォノ基またはホスフォノ基に変じうる基を、 R^2 は水素原子または炭素原子を介して結合する基を、QおよびXはそれぞれ窒素原子はC Hを、YはS、OまたはC H $_2$ を示し、nは0 又は1 を示し、 R^3 及び R^4 は一方が置換されていてもよいピリジニウム基を、他方が水素原子または置換されていてもよい炭化水素基を示すか、あるいは R^3 および R^4 は互いに結合して4 級化した窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示す。〕で表される化合物またはそのエステルあるいはその塩である新規セフェム化合物、その製造法およびそれを含んでなる医薬を提供する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

スペイン フィンラ フランス ガポン EFFGGGGGGGGHHIIIIIIJKKKKL LLLLLLLMMMM ガ英ググルン オタン ガンナジナンニア・ナダ ガンニア・ナビア・ナビア・ナビア・ナインニア・ナイ ツェゴビナ ハルハーハ ベルギー ブルギナ・ファソ ブルガリア BB MMMMMNNNPPRRSS ΒY AFGHIMNUYNEKE キューバ キプロス ロ本 ケニア キルギスタン チェッコドイツ 礼報日 韓国 カザフスタン セントルシア

セフェムまたはカルバセフェム骨格の3位に式

$$-(CH=CH) n-S \left(\begin{array}{c} X \\ \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} R^{4} \\ \end{array} \right) \right)^{+}$$

(式中、R³およびR⁴は一方が置換されていてもよいピリジニウム基を、他方が水素原子または置換されていてもよい炭化水素基を示すか、あるいはR³およびR⁴は互いに結合して4級化した窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示し、Xは窒素原子またはCHを示し、nは0または1を示す。)で示される基を、かつ7位に式

[式中、R¹はホスフォノ基またはホスフォノ基に変じうる基を、R²は水素原子または炭素原子を介して結合する基を、Qは窒素原子またはCHをそれぞれ示す。] で表される基を有することに化学構造上の特徴を有するセフェム化合物またはそのエステルあるいはその塩を初めて合成したところ、該化合物は水に対する溶解性に優れ、優れた抗菌作用等医薬として優れた性質を有することを見出し、これらの知見に基づいて本発明を完成した。

すなわち、本発明は、

10

15

「式中、R'はホスフォノ基またはホスフォノ基に変じうる基を、R'は水素原子または炭素原子を介して結合する基を、QおよびXはそれぞれ窒素原子またはCHを 元し、YはS、OまたはCH₂を示し、nはOまたは1を示し、R3およびR4は一方が置換されていてもよいピリジニウム基を、他方が水素原子または置換されてい

明細書

ホスフォノセフェム誘導体、その製造法および用途

技術分野

5

15

20

25

本発明は広範囲のグラム陽性菌およびグラム陰性菌、特にブドウ球菌、メチシリン耐性ブドウ球菌 (MRSA) およびシュードモナス属の菌などに優れた抗菌作用を有し、しかも水に対して十分な溶解性を有する新規なセフェム化合物、その製造法および医薬特に抗菌剤に関する。

10 背景技術

特開平9-100283号公報には7位に2-(5-アミノ-1.2.4-チアジアゾール-3-イル)-2(Z)-アルコキシイミノアセトアミド基を有し、3位に3または4-(ピリジニウム)チアゾール-4-イルチオ基または環構成原子としてN*を含有する縮合複素環-チオ基を有する具体的なセフェム化合物が種々記載されているが、これらの化合物は水に対する溶解性が十分であるとはいえず、水に溶解する場合には溶解補助剤を用いるのが好ましいなど、製剤特に注射剤として用いる場合に十分満足できるものではない。

また、特開昭 59-31791 号公報には、 $7位に2-(5-ホスフォノアミノ-1.2.4-チアジアゾール-3-イル)-2(2)-メトキシイミノアセトアミド基を有し、<math>3位に置換-(CH=CH)_n-S-とは化学構造が相違する置換-CH2-のピリジニウムメチル基および<math>1-$ メチルピリジニウムチオメチル基を有するセフェム誘導体が記載されている。

最近開発されたメチシリン耐性ブドウ球菌 (MRSA) を含む広範囲の細菌類に 抗菌作用を有するセファロスポリン化合物は、十分な活性を有しているにもかかわ らず、投与に必要な水または生理食塩水に対する溶解性が低く実用化に至っていな い。この点を克服した新しい化合物の出現が望まれていた。

発明の開示

本発明者らは、上記事情に鑑み、鋭意種々研究を重ねた結果、セフェム、オキサ

(9) Qが窒素原子である前記(1)記載の化合物。

(10) Xが窒素原子である前記(1)記載の化合物。

(11) nが0である前記(1)記載の化合物、

5 2,4-チアジアゾール-3-イル)アセトアミド]-3-[4-(1-メチル-4-ピリジニオ)-2-チアゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルボキシレートまたはそのエステルあるいはその塩である前記(1)記載の化合物、

(13) 7β - [2(Z) - フルオロメトキシイミノ-2-(5-ホスフォノアミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル) アセトアミド] - 3-[4-(1-メチル-4-ピリジニオ) - 2-チアゾリルチオ] - 3-セフェム-4-カルボキシレートまたはそのエステルあるいはその塩である前記(1)記載の化合物、

(14) 式:

10

〔式中の記号は前記と同意義を示す。〕で表される化合物またはそのエステルある 15 いはその塩と式:

〔式中, 各記号は前記と同意義である。〕で表されるカルボン酸またはその塩もしくは反応性誘導体とを反応させ、必要に応じてR をホスフォノ基に変換することを特徴とする前記(1)記載の化合物の製造法、

20 (15) 式

てもよい炭化水素基を示すか、あるいはR³およびR⁴は互いに結合して4級化した 窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示す。〕で表される化合物またはそ のエステルあるいはその塩

- (2) R'が保護されていてもよいホスフォノ基である前記(1)記載の化合物、
- (3) R'がホスフォノ、ジアルコキシホスフォリル、〇一アルキルホスフォノ、 ジアミノホスフォリル、(アミノ)(ヒドロキシ)ホスフォリル、(アルコキシ)(モル フォリノ)ホスフォリルまたはジハロホスフォリルである前記(1)記載の化合物
 - (4) R'がホスフォノである前記(1)記載の化合物、
 - (5) YがSである前記(1)記載の化合物、
 - (6) R^2 が置換されていてもよい C_{1-6} アルキル基または C_{3-6} シクロアルキル基である前記(1)記載の化合物、
 - (7) R³が置換されていてもよいピリジニウム基で、R⁴が水素原子である前記(1) 記載の化合物。

15 (8)

10

〔式中、R⁵は置換されていてもよい炭化水素基を示す。〕で示される基である前 記(1)記載の化合物、

15

20

25

に関するものである。

発明を実施するための最良の形態

本明細書におけるセフェム化合物は「ザ・ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ」第84巻、3400頁(1962年)に記載されている「セファム」に基づいて命名された化合物群であり、セフェム化合物はセファム化合物のうち3.4-位に二重結合を有する化合物を意味する。

なお、本発明の化合物は遊離型を表している式(I)の化合物またはそのエステルあるいはその塩(化合物(I)の塩または式(I)の化合物のエステルの塩)を含む。以下本願明細書においては、特別の場合を除き、遊離型を表している式(I)の化合物またはそのエステルあるいはその塩を総称して単に化合物(I)または抗菌化合物(I)と略称することもある。従って本願明細書の化合物(I)は通常、遊離型のみならずそのエステルおよびそれらの塩を含むものとする。

R'はホスフォノ基またはホスフォノ基に変じ得る基を示す。ホスフォノ基に変じ得る基はたとえば加水分解、置換反応により、ホスフォノ基に変換可能な基を意味し、保護されたホスフォノ基の他、たとえばジクロロホスフォリル等のジハロホスフォリルなどが挙げられる

保護されたホスフォノ基はホスフォノ基の保護基によって保護されたものである。核酸化学の分野ではホスフォノ基の保護基は充分に研究されていてその保護法はすでに確立されており、本発明においてもホスフォノ基の保護基としてはそれら公知のものが適宜に採用されうる。保護されたホスフォノ基としてはたとえば、ジクロロホスフォリル等のジハロホスフォリル、たとえばジメトキシホスフォリル、ジエトキシホスフォリル、ジプロポキシホスフォリル等のジアルコキシホスフォリル基、たとえば〇一メチルホスフォノ、〇一エチルホスフォノ等の〇一アルキルホスフォノ基等のようなモノーまたはジーエステルホスフォノ基等、たとえば、ジアミノホスフォリル、(アミノ)(ヒドロキシ)ホスフォリル等のモノまたはジアミド化ホスフォノ基、たとえば、(メトキシ)(アミノ)ホスフォリル、(エトキシ)(アミノ)ホスフォリル基等、たとえば、(メトキシ)(アミノ)ホスフォリル基等、たとえば、(メトキシ)(モルフォリノ)ホスフォリル、(エトキシ)(モルフォリノ)ホスフォリル、(エトキシ)(モルフォリノ)ホスフォリル、(エトキシ)(モルフォリノ

〔式中、R³′ およびR⁴′ は一方が置換されていてもよいビリジル基を、他方が水素原子または置換されていてもよい炭化水素基を示すか、あるいはR³'およびR⁴' は互いに結合して窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示し、その他の記号は請求項1の記載と同意義を示す。〕で表される化合物またはそのエステルあるいはその塩を4級アンモニウム化反応に付し、必要によりR¹をホスフォノ基に変換することを特徴とする前記(1)記載の化合物の製造法、

- (16) 前記(1)記載の化合物を含有してなる医薬.
- (17)前記(1)記載の化合物と薬理学的に許容しうる担体、希釈剤および増量 10 剤の少なくとも1つを含有する医薬。
 - (18) 抗菌組成物である前記(16) 記載の医薬.
 - (19) 抗MRSA剤である前記(16) 記載の医薬、
 - (20) 注射剤である前記(16) 記載の医薬、
 - (21) 医薬の製造のための前記(1) 記載の化合物の使用、
- 15 (22) 医薬が抗菌剤である前記(21) 記載の使用、
 - (23) 医薬が抗MRSA剤である前記(21)記載の使用。
 - (24) 医薬が注射剤である前記(21) 記載の使用、
 - (25)請求項1記載の化合物の有効量を感染症患者に投与することを特徴とする 感染症を治療する方法、
- 20 (26)請求項1記載の化合物の有効量と薬学的に許容しうる担体、希釈剤および 増量剤の少なくとも1つを感染症患者に投与することを特徴とする感染症を治療 する方法、
 - (27)感染症がMRSA感染症である前記(25)記載の方法、

および

25 (28) 注射により投与する前記(25) 記載の方法、

15

20

25

キシ、 C_{6-10} アリールチオなどから選ばれた $1\sim3$ 個の置換基で置換されていてもよい C_{1-6} アルカノイル基が用いられ、具体的にはたとえば、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、バレリル、ピパロイル、サクシニル、グルタリル、モノクロロアセチル、ジクロロアセチル、トリクロロアセチル、モノブロモアセチル、モノフルオロアセチル、ジフルオロアセチル、トリフルオロアセチル、モノヨードアセチル、アセトアセチル、3ーオキソブチリル、4ークロロー3ーオキソブチリル、フェニルアセチル、p-クロロフェニルアセチル、フェノキシアセチル、p-クロロフェノキシアセチルなどが用いられる。

「置換されていてもよいC3-5アルケノイル基」としてはたとえば、ハロゲン、

 C_{s-10} アリールなどから選ばれた $1\sim3$ 個の置換基で置換されていてもよい C_{s-s} アルケノイル基が用いられ、具体的にはたとえば、アクリロイル、クロトノイル、マレオイル、シンナモイル、p-クロロシンナモイル、 $\beta-$ フェニルシンナモイル などが用いられる。

「置換されていてもよい C_{6-10} アリールーカルボニル基」としてはたとえば、ハロゲン、ニトロ、ヒドロキシ、 C_{1-6} アルキル、 C_{1-6} アルコキシなどから選ばれた $1\sim 3$ 個の置換基で置換されていてもよい C_{6-10} アリールーカルボニル基が用いられ、具体的にはたとえば、ベンゾイル、ナフトイル、フタロイル、p-hルイル、p-tert-ブチルベンゾイル、<math>p-tert-ブトキシベンゾイル、p-tert-ブトキシベンゾイル、p-tert-ブトキシベンゾイル、p-tert-ブトキシベンゾイル、p-tert-ブトキシベンゾイル、p-tert-ブトキシベンゾイル、p-tert-ブトキシベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-ブトカベンゾイル、p-tert-

10

15

20

25

)ホスフォリル等の(アルコキシ)(モルフォリノ)ホスフォリル基等のようなモノエステル化モノアミド化ホスフォノ基が挙げられる。R'としてはホスワォノ、ジアルコキシホスフォリル、Oーアルキルホスフォノ、ジアミノホスフォリル、(アミノ)(ヒドロキシ)ホスフォリル、(アルコキシ)(モルフォリノ)ホスフォリルまたはジハロホスフォリルが好ましく、特にホスフォノが好ましい。

R²は水素原子または炭素原子を介して結合する基を表す。

R²で表される「炭素原子を介して結合する基」としてはたとえば、置換されていてもよい炭化水素基(例えば、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、置換されていてもよいアカキール基、置換されていてもよいアカキール基、置換されていてもよいアカキール基、置換されていてもよい環状炭化水素基)、アシル基または炭素原子に結合手を有する置換されていてもよい非芳香族複素環基などが挙げられ、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、置換されていてもよい環状炭化水素基などが好ましい。「置換されていてもよいアルキル基」の「アルキル基」としてはC₁₋₆アルキル基などが好ましく、特にメチル、エチル、

イソプロピルなどが好ましい。「置換されていてもよいアルケニル基」の「アルケニル基」としてはC2-。アルケニル基などが好ましい。

「置換されていてもよいアルキニル基」の「アルキニル基」としては C_{2-6} アルキニル基などが好ましい。「置換されていてもよいアラルキル基」の「アラルキル基」としては C_{7-26} アラルキル基などが好ましい。「置換されていてもよい環状炭化水素基」の「環状炭化水素基」としてはたとえば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペンテンー1ーイル、3ーシクロペンテンー1ーイル、3ーシクロペンテンー1ーイル、2ーシクロペナセンー1ーイル、3ーシクロペキセンー1ーイルなどの3~7員非芳香族環状炭化水素基などが挙げられ、特にシクロブチル、シクロペンチルなどの C_{3-7} シクロアルキル基などが好ましい。

「アシル基」としては、たとえば、「置換されていてもよい C_{1-6} アルカノイル基」、「置換されていてもよい C_{3-6} アルケノイル基」、「置換されていてもよい C_{6-10} アリールーカルボニル基」、「複素環カルボニル基」などが挙げられる。

「置換されていてもよい C_{1-6} アルカノイル基」としてはたとえば、ハロゲン、オキソ、 C_{1-6} アルコキシ、 C_{1-6} アルカノイル、 C_{6-10} アリール、 C_{8-10} アリールオ

用いられる。

カルボキシル基、 C_{1-10} アルコキシーカルボニル基、 C_{6-10} アリールオキシーカルボニル基、 C_{7-10} アラルキルオキシーカルボニル基、 C_{6-10} アリールーカルボニルオキシ基、 C_{1-6} アルカノイル基、 C_{3-6} アルケノイル基、 C_{6-10} アリールーカルボニルオキシ基、 C_{2-6} アルカノイルオキシ基、 C_{3-6} アルケノイルオキシ基、置換されていてもよいカルバモイル基、置換されていてもよいカルバモイル基、置換されていてもよいカルバモイルオキシ基、フタルイミド基、 C_{1-6} アルカノイルアミノ基、 C_{6-10} アリールーカルボニルアミノ基、 C_{7-10} アラルキルオキシーカルボキサミド基、 C_{6-10} アリールオキシーカルボキサミド基、 C_{7-10} アラルキルオキシーカルボキサミド基などが挙げられ、同一または異なって1ないし4個存在していてもよい。前記「炭化水素基」の置換基の具体例のうち、「置換されていてもよいカルバモイル基」としてはたとえば、 C_{1-6} アルキル基、 C_{6-10} アリールカルボニルタノイル基、 C_{6-10} アリールカルボニル基などがら選ばれた1または2個の置換基で置換されていてもよいカルバモイル基および環状アミノカルボニル基などが用いられ、具体的にはたとえば、カルバモイル、N-4

アミノカルボニル基などが用いられ、具体的にはたとえば、カルバモイル、N-メチルカルバモイル、N-エチルカルバモイル、N-ジメチルカルバモイル、N. N-ジエチルカルバモイル、N-フェニルカルバモイル、N-アセチルカルバモイル、N-ベンゾイルカルバモイル、N-(p-メトキシフェニル)カルバモイル、ピロリジノカルボニル、ピベリジノカルボニル、ピベラジノカルボニル、モルホリノカルボニルなどが用いられる。「置換されていてもよいチオカルバモイル基」としてはたとえば、C₁₋₆アルキル基、C₆₋₁₀アリール基などから選ばれた1または2個の置換基で置換されていてもよいチオカルバモイル基が用いられ、たとえば、チオカルバモイル、N-メチルチオカルバモイル、N-フェニルチオカルバモイルなどが用いられる。「置換されていてもよいカルバモイルオキシ基」はたとえば、C₁₋₆アルキル基、C₆₋₁₀アリール基などから選ばれた1または2個の置換基で置換されていてもよいカルバモイルオキシ基が用いられ、具体的にはたとえば、カルバモイルオキシ、N-メチルカルバモイルオキシ、N.N-ジメチルカルバモイル

「炭化水素基」の置換基における複素環基、複素環オキシ基、複素環チオ基およ

オキシ、N-エチルカルバモイルオキシ、N-フェニルカルバモイルオキシなどが

ールー5-イル; 1, 2, 4-オキサジアゾールー3-イルまたは1, 2, 4-オキサ ジアゾールー5ーイル; 1, 2, 5ーまたは1, 3, 4ーオキサジアゾリル: 2-, 4 ジアゾール-4-イルまたは1.2.3-チアジアゾール-5-イル:1.2.4-チ アジアゾール-3 - イルまたは1, 2, 4 - チアジアゾール-5 - イル: 1, 2, 5 -5 または1.3.4-チアジアゾリル:2-または3-ピロリジニル:2-.3-また は4-ピリジル:2-.3-または4-ピリジル-N-オキシド:3-または4-ピリダジニル:3-または4-ピリダジニル-N-オキシド:2-、4-または5 -ピリミジニル:2-,4-または5-ピリミジニル-N-オキシド:ピラジニル 10 ルまたは3H-1インドール-3-1イル; 2-1, 3-1または4-1ピラニル; 2-1, 3-1-または4-チオピラニル;ベンゾピラニル;キノリル;ピリド〔2,3-d〕ピ リミジル; 1,5-,1,6-,1,7-,1,8-,2,6-または2,7-ナフチリ ジル;チエノ〔2.3-d〕ピリジル;ピリミドピリジル:ピラジノキノリル:ベ 15 ンゾピラニルなどが用いられる。

「炭素原子に結合手を有する置換されていてもよい非芳香族複素環基」の「非芳香族複素環基」としてはたとえば、オキシラニル、アゼチジニル、オキセタニル、チエタニル、ピロリジニル、テトラヒドロフリル、チオラニル、ピペリジル、テトラヒドロピラニル、モルホリニル、チオモルホリニルなどの炭素原子以外に窒素原子、酸素原子、硫黄原子などのヘテロ原子を1または2個含む3ないし6員非芳香族複素環基などが好ましい。

前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基としてはたとえば、複素環基、水酸基、C₁₋₆アルコキシ基、C₃₋₁₆シクロアルキル、C₃₋₇シクロアルキルオキシ基、C₆₋₁₆アリールオキシ基、C₇₋₁₉アラルキルオキシ基、複素環オキシ基、メルカプト基、C₁₋₆アルキルチオ基、C₃₋₁₆シクロアルキルチオ基、C₆₋₁₆アリールチオ基、C₇₋₁₆アルキルチオ基、複素環チオ基、アミノ基、モノC₁₋₆アルキルアミノ基、トリC₁₋₆アルキルアンモニウム基、C₃₋₁₆シクロアルキルアミノ基、C₆₋₁₆アリールアミノ基、C₇₋₁₉アラルキルアミノ基、複素環アミノ基、環状アミノ基、アジド基、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、複素環アミノ基、環状アミノ基、アジド基、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、

イルメチル、2-アジドエチル、2-(ピラゾリル)エチル、2-(イミダゾリル) エチル、2 - (2-オキソピロリジン-3-イル) エチル、1 - カルボキシ-1 - (2.3,4-トリヒドロキシフェニル)メチルなどが挙げられる。R²として最 も好ましいものは、たとえばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、プチ ル. イソブチル. sec-ブチル. フルオロメチル, 2-フルオロエチル, 2-クロ ロエチル、2-ヒドロキシエチル、2-メトキシエチル、シアノメチル、カルボキ シメチル. メトキシカルボニルメチル. エトキシカルボニルメチル. カルバモイル メチル、N-メチルカルバモイルメチル、N. N-ジメチルカルバモイルメチルな どのハロゲン、水酸基、C,-,*アルコキシ基、カルボキシル基、C,-,*アルコキシ カルボニル基、シアノ基、カルバモイル基および置換カルバモイルから選ばれた1 10 ないし3個の置換基で置換されていてもよい直鎖状または分枝状のC1-6アルキル 基、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチルなどのC3-5シクロアルキル 基、シクロプロピルメチルなどのC。こ。シクロアルキルーC。こ。アルキル基などが巻 げられる。特に置換されていてもよいC、-。アルキル基およびC、-。シクロアルキル 基が好ましい。 15

R³およびR⁴は一方が置換されていてもよいピリジニウム基を、他方が水素原子 または置換されていてもよい炭化水素基を示すか、あるいはR³およびR⁴は互いに 結合して4級化した窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示す。「置換さ れていてもよいピリジニウム基」としては、たとえば式



20

〔式中、R⁶は置換されていてもよい炭化水素基を、RはC₁₋₆アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、C₁₋₆アルコキシーカルボニル基、アミノ、ニトロ、ハロゲンまたはカルボキシを、pは0ないし4の整数をそれぞれ示す〕で表される基などが用いられる。

25 R³およびR¹が互いに結合して4級化した窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示す場合。

び複素環アミノ基の複素環基としては、前記「複素環カルボニル基」における複素 環基と同様の基が用いられる。

前記「置換されていてもよいアルキル基」の「アルキル基」、「置換されていてもよいアルケニル基」の「アルケニル基」、「置換されていてもよいアラルキル基」の「アラルキル基」および「置換されていてもよい環状炭化水素基」の「環状炭化水素基」が有していてもよい置換基としては、たとえば前記「置換されていてもよい炭化水素基」の「炭化水素基」が有していてもよい置換基と同様のものなどが用いられる。

前記「炭素原子に結合手を有する置換されていてもよい非芳香族複素環基」の置換基としては、前記「置換されていてもよい炭化水素基」において例示した炭化水素基およびその置換基などがあげられる。

R²としては、「置換されていてもよい炭化水素基」などが好ましく、たとえば 水酸基、C3-10シクロアルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6アルキルチオ基、ア ミノ基,ハロゲン原子,カルボキシル基,C.-.。アルコキシカルボニル基,置換さ れていてもよいカルバモイル基、シアノ基、アジド基、複素環基などから選ばれた 15 1ないし3個の置換基で置換されていてもよいC₁₋₆アルキル基などであり、具体 的には、シクロプロピルメチル、メトキシメチル、エトキシメチル、1-メトキシ エチル、2-メトキシエチル、1-エトキシエチル、2-ヒドロキシエチル、メチ ルチオメチル、2-アミノエチル、フルオロメチル、2-フルオロエチル、2.2 20 -ジフルオロエチル、クロロメチル、2-クロロエチル、2,2-ジクロロエチル , 2, 2, 2-トリクロロエチル、2-ブロモエチル、2-ヨードエチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル、カルボキシメチル、1-カルボキシエチル、2-カルボ キシエチル. 2-カルボキシプロピル、3-カルボキシプロピル、1-カルボキシ ブチル,シアノメチル,1-カルボキシ-1-メチルエチル,メトキシカルボニル メチル、エトキシカルボニルメチル、tert-プトキシカルボニルメチル、1-メト 25 キシカルボニルー1-メチルエチル. 1-エトキシカルボニルー1-メチルエチル . 1-tert-プトキシカルボニル-1-メチルエチル. 1-ベンジルオキシカルボ ニルー1-メチルエチル、1-ピバロイルオキシカルボニル-1-メチルエチル、 カルバモイルメチル、N-メチルカルバモイルメチル、N. N-ジメチルカルバモ

10

15

20

25

〔式中の記号は前記と同意義を示す。〕

で表される化合物またはそのエステルあるいはその塩が好ましい。 nは0または 1を示すが、0であるのが好ましい。

前記化合物(I)において4位の-COOの右肩に付した「-」はカルボキシル 基がカルボキシレートアニオンになったものであり、化合物(I)の3位の複素環 (以下A+と称することがある)上の陽電荷と一対になって分子内塩を形成してい ることを示す。一方、化合物(I)は薬理学的に受容されるエステルまたは塩を形 成してもよい。薬理学的に受容される塩としては無機塩基塩、アンモニウム塩、有 機塩基塩、無機酸付加塩、有機酸付加塩、塩基性アミノ酸塩などが用いられる。無 機塩基塩を生成させうる無機塩基としてはアルカリ金属(たとえばナトリウム カ リウムなど), アルカリ土類金属(たとえばカルシウムなど)などが、有機塩基塩を 生成させうる有機塩基としてはたとえばプロカイン、2-フェニルエチルベンジル アミン、ジベンジルエチレンジアミン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、 トリスヒドロキシメチルアミノメタン,ポリヒドロキシアルキルアミン、N-メチ ルグルコサミンなどが、無機酸付加塩を生成させうる無機酸としてはたとえば塩酸 、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸などが、有機酸付加塩を生成させうる有機酸と してはたとえばp-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、ギ酸、トリフルオロ 酢酸、マレイン酸などが、塩基性アミノ酸塩を生成させうる塩基性アミノ酸として はたとえばリジン、アルギニン、オルニチン、ヒスチジンなどが用いられる。これ らの塩のうち塩基塩(すなわち無機塩基塩、アンモニウム塩、有機塩基塩、塩基性 アミノ酸塩) は化合物(I)の置換基R'、R2、R5中にアミノ基、モノアルキルア ミノ基,ジアルキルアミノ基,シクロアルキルアミノ基、アリールアミノ基、アラ ルキルアミノ基、環状アミノ基、含窒素複素環基などの塩基性基が存在する場合に 形成しうる酸付加塩を意味する。また酸付加塩としては化合物(I)の分子内塩を

大
$$R^3$$
 R^3 R^5 R^5

〔式中、qは0ないし3の整数を、その他の記号は前記と同意義を示す〕で表される6員不飽和複素環などが用いられる。

R³、R⁴またはR⁵で示される「置換されていてもよい炭化水素基」としては、

R*で示される「炭素原子を介して結合する基」において例示した「置換されていてもよい炭化水素基」と同様のものが用いられる。

pおよびqは、それぞれ0が好ましい。

R⁵としては、メチルなどのC₁₋₁アルキル基などが好ましい。

R³およびR⁴としては、R³が置換されていてもよいピリジニウム基で、R⁴が水 10 素原子であるか、あるいはR³およびR⁴が互いに結合して4級化した窒素原子を含 む6員不飽和複素環を形成する場合などが好ましい。

QおよびXはそれぞれ窒素原子またはCHを示す。QおよびXはそれぞれ窒素原子が好ましい。

YはS、Oまたは CH_2 を示す。YはSが好ましい。すなわち、化合物(I)とし T ては

20

ルエチルなどが用いられる。

「 C_{2-n} アルケニルエステル」を形成する C_{2-n} アルケニル基としてはビニル,アリル、1-プロペニル、イソプロペニル、1-プテニル、2-プテニル、3-プテニル、メタリル、1、1-ジメチルアリル、3-メチル-3-ブテニルなどが用いられる。

 $[C_{3-10}$ シクロアルキルエステル」を形成する C_{3-10} シクロアルキル基としては シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、ノルボルニル、アダマンチルなどが用いられる。

「C₃₋₁₀シクロアルキルC₁₋₆アルキルエステル」を形成するC₃₋₁₀シクロアル 10 キルC₁₋₆アルキル基としてはシクロプロピルメチル、シクロベンチルメチル、シ クロヘキシルメチルなどが用いられる。

「置換されていてもよい C_{s-10} アリールエステル」を形成する「 C_{s-10} アリール基」としてはたとえばフェニル, α ーナフチル, β ーナフチル,ビフェニリル等が用いられ、それらは例えば、ニトロ,ハロゲン(例、フッ素、塩素、臭素等)等で $1\sim3$ 個置換されていてもよく、そのような基として具体的には例えば、pーニトロフェニル,pークロロフェニルなどが用いられる。

「置換されていてもよい C_{7-12} アラルキルエステル」を形成する「 C_{7-12} アラルキル基」としてはたとえば、ベンジル、1-7ェニルエチル、2-7ェニルエチル、フェニルプロビル、ナフチルメチル等が用いられ、それらは例えば、ニトロ、 C_{1-4} アルコキシ(例、メトキシ等)、 C_{1-4} アルキル(例、メチル、エチル等)、ヒドロキシで $1\sim 3$ 個置換されていてもよく、そのような基として具体的には例えば、p-ニトロベンジル、p-メトキシベンジル、3、5-ジtert-ブチル-4-ヒドロキシベンジルなどが用いられる。

「ジ $C_{\kappa-1n}$ アリール-メチルエステル」を形成するジ $C_{\kappa-1n}$ アリール-メチル基としてはベンズヒドリルなどが、トリ $C_{\kappa-1n}$ アリール-メチルエステルを形成するトリ $C_{\kappa-1n}$ アリール-メチル基としてはトリチルなどが、置換シリルエステルを形成する置換シリル基としてはトリメチルシリル、tert-ブチルジメチルシリル、- $Si(CH_3)_2CH_2CH_2Si(CH_3)_2$ -などが、 C_{2-6} アルカノイルオキシ- C_{1-6} アルキルエステルとしては、たとえばアセトキシメチルエステルなどが用いられる

15

20

形成している部分、すなわち 4 位のカルボキシレート(COO^-)と 4 位の複素環部分の陽電化「+」に酸が 1 モル付加して 4 位がカルボキシル基。 3 位が一(CH=CH)。 $_{n}-S-A^{+}Z^{-}$ [(式中、Z-は無機酸、有機酸からプロトンH+を取り除いてできるたとえばクロライドイオン、プロマイドイオン、スルフェートイオン、p-トルエンスルホネートイオン、メタンスルホネートイオン、トリフルオロアセテートイオンなどのアニオンを示す)となった塩も含まれる。化合物(I)のエステル誘導体は分子中に含まれるカルボキシル基をエステル化することにより生成されうるエステルを意味し、合成中間体として利用できるエステルおよび代謝上不安定な無毒のエステルである。合成中間体として利用できるエステルとしては置換されていてもよい C_{1-n} アルキルエステル、 C_{2-n} アルキルエステル、 C_{3-10} シクロアルキルエステル、 C_{3-10} シクロアルキルエステル、 C_{3-10} シクロアルキルエステル、間換されていてもよい C_{5-10} アリールエステル、置換されていてもよい C_{5-10} アリールエステル、「電換さりルエステル、アリールーメチルエステル、ドリ C_{6-10} アリールーメチルエステル、トリ C_{6-10} アリールーメチルエステル、「電換シリルエステル、 C_{2-6} アルカノイルオキシー C_{1-6} アルキルエステルなどが用いられる。

 チル、tーブチルなど:

 C_{1-4} アルキル基:上記 C_{1-4} アルキル基及びペンチル、 2, 2 - 2 +

 C_{2-8} アルケニル基:ビニル、アリル、1-プロペニル、1-プラニル、1-プテニル、1-プテニル、1-プテニル、1-プテニル、1-プテニル、1-プテニル、1-

 C_{2-6} アルキニル基:エチニル、1-プロピニル、2-プロピニル、2-プチニル、2-ペンチニル、2-ヘキシニルなど:

 $C_{\mathfrak{z-s}}$ シクロアルキル基:シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチルなど

10

25

 C_{3-10} シクロアルキル基:上記 C_{3-5} シクロアルキル基及びシクロヘキシル、シクロペプチル、シクロオクチル、シクロデシルなど:

C₆₋₁₀アリール基:フェニル、ナフチルなど:

 C_{7-2n} アラルキル基: ベンジル、1-フェニルエチル、2-フェニルエチル、フ 15 ェニルプロピル、ナフチルメチル、ベンズヒドリルなど;

 C_{1-6} アルコキシ基: メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソプトキシ、t ープトキシ、ペンチルオキシ、2, 2 ージメチルプロビルオキシ、ヘキシルオキシなど・

 C_{3-7} シクロアルキルオキシ基:シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、

20 シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシなど:

C₆₋₁₀アリールオキシ基:フェノキシ、ナフチルオキシなど:

 C_{7-19} アラルキルオキシ基: ベンジルオキシ、1-フェニルエチルオキシ、2-フェニルエチルオキシ、ベンズヒドリルオキシなど:

C₁-₈アルキルチオ基:メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、ブチルチオ、 イソブチルチオ、t - ブチルチオ、ペンチルチオ、2.2 - ジメチルプロピルチオ 、ヘキシルチオなど:

 C_{3-10} シクロアルキルチオ基:シクロプロピルチオ、シクロブチルチオ、シクロペンチルチオ、シクロヘキシルチオ、シクロヘプチルチオ、シクロオクチルチオ、シクロデシルチオなど:

10

。前記したエステルには4位のエステルも含む。このように4位が前記のエステル 基であるものは3位に式

 $-(CH=CH)_{0}-S^{-}A+Z^{-}$

〔式中の記号は前記と同意義を示す〕で表される基を有する塩を形成している。

本発明は前記エステル誘導体のほかに、生体内において化合物(I)に変換される薬理学的に受容しうる化合物も包含する。

本発明の化合物 (I) および原料化合物のn=1 の場合においては、シス異性体 $(Z\Phi)$ 、トランス異性体 $(E\Phi)$ およびシス、トランス混合物が包含されるものとする。本発明の化合物 (I) は、トランス異性体 $(E\Phi)$ が好ましい。

化合物(1)については、例えばシス異性体(Z体)は式

で表わされる部分構造を有する幾何異性体の1つを意味し、トランス異性体は式

で表わされる部分構造を有する幾何異性体を意味する。

化合物(I)中、特に好ましい化合物としては、たとえば7β-[2(Z)-エトキシイミノ-2-(5-ホスフォノアミノ-1,2、4-チアジアゾール-3-イル)アセトアミド]-3-[4-(1-メチル-4-ピリジニオ)-2-チアゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルボキシレートまたはそのエステルあるいはその塩および7β-[2(Z)-フルオロメトキシイミノ-2-(5-ホスフォノアミノ-1,2、4-チアジアゾール-3-イル)アセトアミド]-3-[4-(1-メチル-4-ピリジニオ)-2-チアゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルボキシレートまたはそのエステルあるいはその塩が挙げられる。

本願明細書において特に明記されていない場合の各置換基の具体例は次の通りである。

25 ハロゲン:フルオロ、クロロ、ブロモ、ヨードなど;

C₁₋₄アルキル基:メチル、エチル、プロピル、イソブロピル、ブチル、イソブ

C₂₋₆アルカノイルオキシ基:アセトキシ、プロピオニルオキシ、ブチリルオキシ、パレリルオキシ、ピパロイルオキシなど:

C₃₋₅アルケノイル基:アクリロイル、クロトノイル、マレオイルなど:

C₃₋₃アルケノイルオキシ基:アクリロイルオキシ、クロトノイルオキシ、マレ オイルオキシなど・

 C_{s-1s} アリールーカルボニル基: ベンゾイル、ナフトイル、フタロイル、フェニルアセチルなど;

C_{n-10}アリールーカルボニルオキシ基:ベンゾイルオキシ、ナフトイルオキシ、 フェニルアセトキシなど;

10 C₁₋₆アルコキシーフェニル基:メトキシフェニル、エトキシフェニル、プロポキシフェニル、ブトキシフェニル、tープトキシフェニルなど:

 C_{1-10} アルコキシーカルボニル基:メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロボキシカルボニル、イソプロボキシカルボニル、ブトキシカルボニル、イソプトキシカルボニル、t - ブトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボニル、2.2 - ジメチルプロピルオキシカルボニル、ヘキシルオキシカルボニル、ヘプチルオキシカルボニル、デシルオキシカルボニルなど:

C2-10アルケニルオキシーカルボニル基:アリルオキシカルボニルなど・

 C_{s-10} アリールオキシーカルボニル基:フェノキシカルボニル、ナフチルオキシカルボニルなど

20 C₇₋₁₉アラルキルオキシーカルボニル基:ベンジルオキシカルボニル、ベンズヒ ドリルオキシカルボニルなど:

C₁₋₁₀アルコキシーカルボキサミド基:メトキシカルボキサミド (CH₃OCONH-)、エトキシカルボキサミド、tert-ブトキシカルボキサミドなど:

C₆₋₁₀アリールオキシーカルボキサミド基:フェノキシカルボキサミド (C₆H_s

25 OCONH-) など;

15

本発明の化合物(1)の製造法を以下に詳しく述べる。

製造法(1):

たとえば式(II)で表される化合物またはその塩またはそのエステル(以下化合物(II)という)と式(III)で表される化合物またはその塩もしくはその反応性

C₆₋₁₀アリールチオ基:フェニルチオ、ナフチルチオなど:

C₇₋₁₉アラルキルチオ基:ベンジルチオ、フェニルエチルチオ、ベンズビドリルチオ、トリチルチオなど:

 C_{1-4} アルキルスルフィニル基:メチルスルフィニル、エチルスルフィニル、プロピルスルフィニル、イソプロピルスルフィニル、ブチルスルフィニル、t-プチルスルフィニルなど:

C₁₋₄アルキルスルホニル基:メチルスルホニル、エチルスルホニル、プロピルスルホニル、イソプロピルスルホニル、ブチルスルホニル、イソブチルスルホニル、t-ブチルスルホニルなど:

10 モノC₁₋₆アルキルアミノ基:メチルアミノ、エチルアミノ、n-プロビルアミノ、n-プチルアミノなど:

yC₁₋₄アルキルアミノ基: ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、メチルエチルアミノ、ジー(n-プロピル)アミノ、ジー(n-ブチル)アミノなど:

 \mathcal{G}_{1-6} アルキルアミノ基:上記 \mathcal{G}_{1-6} アルキルアミノ基及び $\mathcal{G}(\mathcal{G})$ (ペンチル) アミノ、 $\mathcal{G}(\mathbf{n}-\mathbf{n}+\mathbf{n})$ アミノなど:

トリC,-6アルキルアンモニウム基:トリメチルアンモニウムなど:

 C_{3-10} シクロアルキルアミノ基:シクロプロピルアミノ、シクロペンチルアミノ、シクロヘキシルアミノなど:

C₆₋₁₀アリールアミノ基:アニリノ、N-メチルアニリノなど;

20 C₇₋₁₉アラルキルアミノ基:ベンジルアミノ、1-フェニルエチルアミノ、2-フェニルエチルアミノ、ベンズヒドリルアミノなど:

環状アミノ基: ピロリジノ、ピペリジノ、ピペラジノ、モルホリノ、1-ピロリルなど;

C₁₋₆アルカノイルアミノ基:アセトアミド、プロピオンアミド、ブチロアミド 25 、バレロアミド、ピバロアミドなど:

 $C_{\kappa-1,n}$ アリールーカルボニルアミノ基: ベンズアミド、ナフトイルアミド、フタルイミドなど:

 C_{1-6} アルカノイル基:ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、バレリル、ピバロイル、サクシニル、グルタリルなど・

10

15

20

25

してはたとえば酸ハライド、酸アジド、酸無水物、混合酸無水物、活性アミド、活 性エステル、活性チオエステルなどの反応性誘導体がアシル化反応に供される。酸 ハライドとしてはたとえば酸クロライド、酸プロマイドなどが、混合酸無水物とし てはモノCilaアルキル炭酸混合酸無水物(たとえば遊離酸とモノメチル炭酸、モ ノエチル炭酸、モノイソプロピル炭酸、モノイソブチル炭酸、モノtert - ブチル炭 酸、モノベンジル炭酸、モノ(n-ニトロベンジル)炭酸、モノアリル炭酸などと の混合酸無水物)、 C1-8脂肪族カルボン酸混合酸無水物(たとえば游離酸と酢酸 、トリクロロ酢酸、シアノ酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、イソ吉 草酸、ピバル酸、トリフルオロ酢酸、トリクロロ酢酸、アセト酢酸などとの混合酸 無水物)、Czzzz芳香族カルボン酸混合酸無水物(たとえば遊離酸と安息香酸、p ートルイル酸、pークロロ安息香酸などとの混合酸無水物)、有機スルホン酸混合 酸無水物(たとえば遊離酸とメタンスルホン酸、エタンスルホン酸、ベンゼンスル ホン酸、p-トルエンスルホン酸などとの混合酸無水物)などが、活性アミドとし ては含窒素複素環化合物とのアミド〔たとえば遊離酸とピラゾール、イミダゾール 、ベンゾトリアゾールなどとの酸アミドで、これらの含窒素複素環化合物はClass アルキル基(例、メチル、エチル等)、C1-6アルコキシ基(例、メトキシ、エト キシ等)、ハロゲン原子(例、フッ素、塩素、臭素等)、オキソ基、チオキソ基、 C₁₋₆アルキルチオ基(例、メチルチオ、エチルチオ等)などで置換されていても よい。)などがあげられる。

活性エステルとしては β – ラクタムおよびペプチド合成の分野でこの目的に用いられるものはすべて利用でき、たとえば有機リン酸エステル(たとえばジエトキシリン酸エステル、ジフェノキシリン酸エステルなど)のほか p – ニトロフェニルエステル、2、4 – ジニトロフェニルエステル、シアノメチルエステル、ベンタクロフェニルエステル、Nーヒドロキシサクシンイミドエステル、Nーヒドロキシフタルイミドエステル、1 – ヒドロキシベンゾトリアゾールエステル、6 – クロロー1 – ヒドロキシベンゾトリアゾールエステル、1 – ヒドロキシー1 H – 2 – ピリドンエステルなどがあげられる。活性チオエステルとしては芳香族複素環チオール化合物とのエステル(たとえば2 – ピリジルチオールエステル、2 – ベンゾチアゾリルチオールエステルなどで、これらの複素環は C_{1-n} アルキル基(例、メチル、

15

20

25

ンスルホン酸塩などがあげられる。

誘導体(以下化合物(III)という)とを反応させ、必要に応じて保護基を除去することによりR'をホスフォノ基に変換して化合物(I)を合成することができる。本法は化合物(II)を化合物(III)でアシル化する方法である。化合物(II)は遊雕のまま、その塩あるいはエステルとして用いられる。化合物(II)の塩としては無機塩基塩、アンモニウム塩、有機塩基塩、無機酸付加塩、有機酸付加塩などがあげられる。無機塩基塩としてはアルカリ金属塩(たとえばナトリウム塩、カリウム塩など)、アルカリ土類金属塩(たとえばカルシウム塩など)などが、有機塩基塩としてはたとえばトリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、tertーブチルジメチルアミン塩、ジベンジルメチルアミン塩、ベンジルジメチルアミン塩、N,Nージメチルアニリン塩、ピリジン塩、キノリン塩などが、無機酸付加塩としてはたとえば塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩などが、有機酸付加塩としては半酸塩、酢酸塩、ドリフルオロ酢酸塩、メタンスルホン酸塩、 pートルエ

アミノ化合物(II)のエステルとしては化合物(I)のエステル誘導体としてすでに述べたエステルがここでもそのままあげられる。すなわち C_{1-6} アルキルエステル、 C_{2-6} アルケニルエステル、 C_{3-10} シクロアルキルエステル、 C_{3-10} シクロアルキルエステル、 C_{7-12} アラルキルエステル、 C_{7-12} アラルキルエステル、ジー C_{6-10} アリールメチルエステル、トリー C_{6-10} アリールメチルエステル、シー C_{6-10} アリールメチルエステル、トリー C_{6-10} アリールメチルエステル、アル、 C_{2-6} アルカノイルオキシー C_{1-6} アルキルエステルなどが挙げられる。

化合物 (II) はたとえば、特開平9-100283号公報などに記載の方法によって製造することができる。

この方法において化合物 (III) は遊離のまま、またはその塩あるいはその反応性誘導体がアミノ化合物 (II) の7位アミノ基のアシル化剤として用いられる。化合物 (III) の塩としては無機塩基塩、有機塩基塩が挙げられ、無機塩基塩としてはアルカリ金属塩 (たとえばナトリウム塩、カリウム塩など)、アルカリ土類金属塩 (たとえばカルシウム塩など)などが、有機塩基塩としてはたとえばトリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、tert - ブチルジメチルアミン塩、ベンジルメチルアミン塩、ベンジルジチルアミン塩、ベンジルジチルアミン塩、バンジルジチルアミン塩、ボンジルジメチルアミン塩、ボンジルジメチルアミン塩、ボンジルジメチルアミン塩、ドリジン塩、キノリン塩などが挙げられる。化合物 (III) のカルボン酸の反応性誘導体と

化合物 (III) の使用量は化合物 (II) 1モルに対して通常約1~5モル、好ま しくは約1~2モルである。反応は約-80~80℃、好ましくは約-40~50 ℃、最も好ましくは約 $-30\sim30$ ℃の温度範囲で行われる。反応時間は化合物 (II) および化合物 (III) の種類、溶媒の種類 (混合溶媒の場合はその混合比も) 、反応温度などに依存し、通常約1分~72時間、好ましくは約15分~3時間である 。アシル化剤として酸ハライドを用いた場合は放出されるハロゲン化水素を反応系 から除去する目的で脱酸剤の存在下に反応を行うことができる。このような脱酸剤 としてはたとえば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素ナト リウムなどの無機塩基、たとえばトリエチルアミン、トリ (n-プロピル) アミン 、トリ (n-ブチル) アミン、ジイソプロピルエチルアミン、シクロヘキシルジメ チルアミン、ピリジン、ルチジン、ァーコリジン、N. N – ジメチルアニリン、N - メチルピペリジン、N-メチルピロリジン、N-メチルモルホリンなどの第3級 アミン、たとえばプロピレンオキシド、エピクロルヒドリンなどのアルキレンオキ シドなどが挙げられる。R¹が水素原子で、反応性誘導体生成時に、同時に保護さ れていてもよいホスフォノ基の導入が生じる場合は、R'がジハロホスフォリル基 である反応混合物は、さらに水で処理することにより脱保護してR'がホスフォノ 基である化合物(I)として得てもよく、また同じ反応混合物をさらにたとえばメ タノール、エタノール等のアルカノールのようなアルコール等で処理して、R¹が

20 製造法(2):

10 -

15

化合物 (I) のうち式:

エステル化されたホスフォノ基である化合物(I)を得てもよい。

(式中、各記号は前記と同意義である)で表される化合物またはその塩(以下化合物(la)ということもある)は、たとえば、式:

エチル等)、C₁₋₆アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ等)、ハロゲン原子(例、フッ素、塩素、臭素等)、C₁₋₆アルキルチオ基(例、メチルチオ、エチルチ オ等)などで置換されていてもよい。〕が挙げられる。

化合物(III)は公知の方法(例えば、特開昭60-231684号、特開昭 62-149682号、EP0590681等に記載の方法) またはそれに準ずる 5 方法によって容易に製造できる。化合物(III)の反応性誘導体は反応混合物から 単離された物質として化合物(II)と反応させてもよいし、または単離前の化合物 (III) の反応性誘導体を含有する反応混合物をそのまま化合物 (II) と反応させ ることもできる。化合物(III)を遊離酸または塩の状態で使用する場合は適当な 10 縮合剤を用いる。縮合剤としてはたとえばN、N'ージシクロヘキシルカルボジィ ミドなどのN.N'-ジ置換カルボジイミド類、たとえばN.N'-カルボニルジイ ミダゾール、N. N' -チオカルボニルジイミダゾ-ルなどのアゾライド類、たと えばN-エトキシカルボニル-2-エトキシ-1.2-ジヒドロキノリン、オキシ 塩化リン、アルコキシアセチレンなどの脱水剤、たとえば2-クロロピリジニウム 15 メチルアイオダイド、2-フルオロピリジニウムメチルアイオダイドなどの2-ハ ロゲノピリジニウム塩類などが用いられる。これらの縮合剤を用いた場合、反応は 化合物(III)の反応性誘導体を経て進行すると考えられる。反応は一般に溶媒中 で行なわれ、反応を阻害しない溶媒が適宜に選択される。このような溶媒としては たとえばジオキサン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、tertーブチルメチ ルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコールージメチルエーテルな 20 どのエーテル類、たとえばギ酸エチル、酢酸エチル、酢酸n-ブチルなどのエステ ル類、たとえばジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、トリクレン、1,2 -ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、たとえばn-ヘキサン、ベンゼン 、トルエンなどの炭化水素類、たとえばホルムアミド、N. N-ジメチルホルムア ミド、N. N - ジメチルアセトアミドなどのアミド類、たとえばアセトン、メチル 25 エチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン類、たとえばアセトニトリル 、プロピオニトリルなどのニトリル類などのほか、ジメチルスルホキシド、スルホ ラン、ヘキサメチルホスホルアミド、水などが単独または混合溶媒として用いられ る。

〔式中、各記号は前記と同意義である。〕で表わされる化合物またはその塩類(以下化合物(Ic)ということもある)が得られる。

製造法 (3):

化合物 (Ia) は、たとえば、化合物 (Ic) を保護基の脱離反応に付すことによりホスフォノ基の保護基を脱離させて製造することができる。

本法は、たとえば、化合物(Ic)を、酸等を用いて行うことができる。好適な酸としては、有機酸または無機酸が挙げられ、たとえばギ酸、硫酸、トリフルオロ酢酸、ベンゼンスルホン酸、硝酸、P-トルエンスルホン酸、塩酸等がその例であるが、好ましい酸は、たとえば、ギ酸、トリフルオロ酢酸、塩酸等である。反応に適した酸は、加水分解すべき基の種類によって選択される。この反応は溶媒を用いて、あるいは用いる事なく行われる。好適な溶媒としては、慣用の有機溶媒、水またはそれらの混合物が挙げられる。トリフルオロ酢酸を使用する場合、アニソール存在下に反応を行うことが望ましい。

製造法4

15 式:

10

20

25

$$\begin{array}{c|c}
NH_{2} & S & Q \\
N & & & \\
N & & \\
N & & & \\
N$$

〔式中、記号は前記と同意義を示す。〕で表わされる化合物またはその塩類(以下化合物 (V) ということもある)をリン酸誘導体と縮合することによって化合物 (I) を製造することができる。

本法は、たとえば、化合物 (V) またはその塩類に対し、たとえば三塩化リン、 五塩化リン等のハロゲン化リン、オキシ塩化リン等のオキシハロゲン化リン等を用いて行うことができる。反応は通常、たとえば塩化メチレン、塩化エチレン等のハロゲン化アルキレン、トルエン等の溶媒中で行われる。反応温度は限定されず、通常冷却下、常温ないし加温化に反応が行われる。この反応においては、得られた化合物 (I) のR'がジハロホスフォリル基である反応混合物は、さらに水で処理してR'がホスフォノ基である化合物 (I) として得てもよく、また同じ反応混合物をさ

10

15

20

$$\begin{array}{c|c}
R^{\delta} & 0 \\
R^{7} & P-NH \\
N & 0 \\
\hline
 & 0 \\
\hline$$

〔式中、R⁶およびR⁷は同一または異なってホスフォノ基の保護基、その他の記号は前記と同意義を示す。〕で表わされる化合物またはその塩類(以下化合物(Ib)ということもある)のホスフォノ基の保護基を脱離反応に付すことによりR¹をホスフォノ基に変換して製造することができる。

 R^6 および R^7 で示されるホスフォノ基の保護基としては、たとえばハロゲン (塩素原子など)、アルコキシ (例、メトキシ、エトキシ、プロポキシなど炭素数 $1 \sim 3$ のもの)、アミノ、モルフォリノ、チオモルホリノなどが挙げられる。

本法は、たとえば、化合物 (Ib) を、たとえば臭化トリメチルシリル、ヨウ化トリメチルシリル、塩化トリメチルシリル等のハロゲン化トリメチルシリル、たとえばヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム、臭化ナトリウム等のハロゲン化金属、たとえばチオシアン酸ナトリウム、チオシアン酸カリウム等のチオシアン酸アルカリ金属等と反応させることによって行うことができる。反応は好ましくは、塩化メチレン、ジメチルアセトアミドのような溶媒中で行われるが、反応に影響を及ぼさない有機溶媒であればいかなる溶媒中でも行うことができる。反応温度は特に限定されず、通常冷却下、常温ないしは若干加熱する程度の温和な条件下に反応が行われる。

なおこの反応において、化合物(Ib)の R^* と R^7 が異なる場合には、反応条件を選択することにより、 R^4 および R^7 の一方のみの保護基を除去することができ、この場合式:

$$\begin{array}{c|c}
R^{5} & 0 \\
HO & P-NH \\
N & OR^{2} & O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CO-NH & S \\
COO-NH & S \\
COO-NH & S
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH=CH) & n-S \\
COO-NH & S
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{3} & O \\
R^{4} & O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
COO-NH & S \\
COO-NH & S
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
COO-NH & S \\
COO-NH & S
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
COO-NH & S \\
COO-NH & S
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
COO-NH & S
\end{array}$$

10

15

20

25

ン塩等の有機塩基との塩が挙げられる。化合物 (VI) のカルボキシ基における好適な反応性誘導体としては、化合物 (III) について例示したものを挙げることができる。

このエステル化反応に使用すべきエステル化剤としては、式:..

 $(R^{8})_{2}SO_{4}, R^{8*}-N_{2}$ $\pm k$ $R^{8}-X^{1}$

〔式中、R*は前記と同意義であり、R**はR*から水素を脱離した基、X'はヒドロキシまたはハロゲンをそれぞれ意味する。)で示される化合物が挙げられる。好適なハロゲンとしては塩素、臭素、ヨウ素又はフッ素が挙げられる。

硫酸エステル、およびアルキルハライドをエステル化剤として用いる場合、反応は通常、水、アセトン、塩化メチレン、エタノール、エーテル、ジメチルホルムアミドのような溶媒中で行われるが、反応に影響を及ぼさない溶媒であれば、その他いかなる溶媒中でも行うことができる。反応は好ましくは、前記の無機塩基もしくは有機塩基の存在下行われる。反応温度は特に限定されず、通常は冷却下から溶媒の沸点周辺の温度までの加熱下の範囲で反応が行われる。

エステル化剤としてジアゾ化合物を用いる場合、エーテル、テトラヒドロフラン 等の溶媒中行われ、反応温度は特に限定されず、通常冷却下又は常温で反応が行われる。

化合物 (VII) の好適な塩類としては、たとえば酢酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩等の有機酸塩、または、たとえば塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、リン酸塩等の無機酸塩のような酸付加塩等が挙げられる。

製法BおよびD

化合物 (VI) または化合物 (VII) をそれぞれアミノ基へ、保護されていてもよいホスフォノ基の導入反応に付すことによって式 (III) で表される化合物またはそのカルボキシル基における反応性誘導体またはその塩 (以下化合物 (III) という) または式 (IIIa) で表される化合物またはそのカルボキシル基における反応性誘導体またはそのカルボキシル基における反応性誘導体またはその塩 (以下化合物 (IIIa) という) を製造することができる。

化合物 (VI) および (VII) のカルボキシ基における反応性誘導体として好適な ものは、化合物 (III) について例示したものが挙げられる。 らにたとえばメタノール、エタノール等のアルカノールのようなアルコール等で処理して、R¹がエステル化されたホスフォノ基である化合物(I)を得てもよい。

前記製造法(1)~(4)に記載した方法により製造した化合物(I)はたとえば抽出法、カラムクロマトグラフィー、沈澱法、再結晶法などの公知の処理手段によって単離精製することができる。一方、単離された化合物(I)を公知の方法により所望の生理学的に受容される塩へと変換することもできる。

原料化合物(III)の製造法を以下詳細に説明する。

製法A

10

15

上記式中、 R^* は式: CO_2R^* によって表されるエステル化されたカルポキシル基のエステル部分を示す。

式(VI)で表される化合物またはそのカルボキシル基における反応性誘導体またはその塩類(以下化合物(VI)ということもある)をエステル化反応に付すことにより式(VII)で表される化合物またはその塩類(以下化合物(VII)ということもある)を製造することができる。

化合物 (VI) の好適な塩類としては、たとえばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩、たとえばカルシウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩のような金属塩、アンモニウム塩、たとえばトリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、ピリジン塩、ピコリン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、パパージベンジルアミ

10

反応は通常、水、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、たとえばメタノール、エタノール等のアルコール、またはそれらの混合物中で行われるが、反応に影響を及ぼさない溶媒であれば、その他のいかなる溶媒中でも行い得る。液体状の塩基または酸も溶媒として使用することができる。反応温度は特に限定されず、通常冷却下ないし加温下の範囲で行われる。

還元は好ましくは、4-二トロベンジル、2-ヨウ化エチル、2.2.2-トリクロロエチル等のようなエステル部分の脱保護に適用することができる。脱エステル反応に適用され得る還元法としては、たとえば亜鉛、亜鉛アマルガム等の金属、または、たとえば塩化第一クロム、酢酸第一クロム等のクロム化合物塩と例えば酢酸、プロピオン酸、塩酸等の有機酸もしくは無機酸との組み合わせを用いる還元法、および、たとえばパラジウムー炭素等の常用の金属触媒の存在下における接触還元法が挙げられる。

原料化合物である式(IIId)で表される化合物またはその反応性誘導体またはその塩(以下化合物(IIId)という)の製法を以下に述べる。

[式中、R"°はジハロホスフォリル基を、R'°は保護されていてもよいホスフォノ 基を示す。(R'°はR'と同じ定義であるが、R'とは異なっていてもよい)]

製法E

15

20

化合物 (VII) をアミノ基へのジハロホスフォリル基の導入反応に付すことにより式 (IIIb) で表される化合物またはその反応性誘導体またはその塩 (以下化合物 (IIIb) という) を製造することができる。

この導入反応に使用すべき好適な導入剤としては、たとえば三塩化リン、五塩化リン等のハロゲン化リン、オキシ塩化リン等が挙げられる。この反応は通常、たとえば塩化メチレン、塩化エチレン等のハロゲン化アルキレン、トルエン、酢酸エチル、テトラヒドロフラン等の溶媒中で行われる。この反応においては、化合物(VI)または(VII)をたとえばハロゲン化リン等の上記導入剤と反応させることによって得られた、R'がジハロホスフォリル基である反応混合物は、さらに水で処理してR'がホスフォノ基である化合物(III)または(IIIa)として得てもよく、また同じ反応混合物をさらにたとえばメタノール、エタノール等のアルカノールのようなアルコール等で処理して、R°がエステル化されたホスフォノ基である化合物(III)または(IIIa)を得てもよい。R°がジハロホスフォリル基である化合物(III)または(IIIa)の反応生成物は上述の反応混合物から慣用の単離方法によって得られ、次の工程の反応に使用され得る。

化合物 (IIIa) のカルボキシ基が反応中にその反応性誘導体に変化する場合も、この反応の範囲内に包含される。

15 製法C

10

20

25

化合物 (IIIa) を脱エステル化反応に付すことにより化合物 (III) を製造することができる。

好適な化合物(III)の塩類としては、化合物(VI)について例示したものを挙げることができる。

この反応は加水分解、還元等の常法によって行うことができる。加水分解反応は好ましくは塩基または酸の存在下に行われる。好適な塩基としては、たとえばナトリウム、カリウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属、上記金属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩、たとえばトリメチルアミン、トリエチルアミン等のトリアルキルアミン、ピコリン、1.5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン、1.4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン、1.8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカン等のような無機塩基および有機塩基が挙げられる。好適な酸としては、たとえば半酸、酢酸、プロビオン酸、トリフルオロ酢酸等の有機酸、塩酸、臭化水素酸、硫酸等の無機酸が挙げられる。トリフルオロ酢酸は、たとえばアニソール等の陽イオン捕捉剤の存在下に使用されることが望ましい。

この反応は、製法BおよびDの方法に準じて行うことができる。

製法F

10

15

25

化合物(IIIb)をジハロホスフォリル基のジハロホスフォリル基以外のホスフォ ノ基への変換反応に付すことにより式(IIIc)で表される化合物またはその反応性 誘導体またはその塩(以下化合物(IIIc)という)を製造することができる。

この変換反応は、化合物 (IIIb) をエステル化および/またアミド化反応に付す ことにより行うことができる。

このエステル化反応は、化合物(IIIb)をアルコールと反応させることにより行うことができる。好適なアルコールとしては、たとえばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール等が挙げられる。アミド化反応は、化合物(IIIb)をアミンと反応させることにより行うことができる。好適なアミンとしては、アンモニア、たとえばメチルアミン、エチルアミン等の第一級アミン、たとえばモルホリン、ジメチルアミン等の第二級アミン等が挙げられる。

このエステル化反応またはアミド化反応は通常、たとえば塩化メチレン、塩化エ チレン等のハロゲン化アルキレン、テトラヒドロフラン、水のような溶媒中で行わ れるが、反応に影響を及ぼさない溶媒であればその他いかなる溶媒中でも行うこと ができる。

反応温度は特に限定されず、通常は冷却下または常温で反応が行われる。 製法G

20 化合物(IIIc)を脱エステル化反応に付すことにより化合物(IIId)を製造することができる。

この反応は、製法Cに準じて行うことができる。

前記本発明の各反応において、化合物が置換基としてアミノ基、カルボキシル基 、ヒドロキシル基を有する場合、これらの基にペプチド化学などで一般的に用いら れているような保護基が導入されていてもよく、反応後に必要に応じて保護基を除 去することにより目的化合物を得ることができる。

アミノ基の保護基としては、例えばホルミル基、C₁₋₈アルキルカルボニル基 (例えば、アセチル、エチルカルボニルなど)、ベンジル基、tertープチルオキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシカルボ

20

25

ニル基、アリルオキシカルボニル基、フェニルカルボニル基、C₁₋₆アルキルオキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニルなど)、C₇-10アラルキルカルボニル基(例えば、ベンジルカルボニルなど)、トリチル基、フタロイル基、N、N-ジメチルアミノメチレン基などが用いられる。これらの基は1ないし3個のハロゲン原子(例えば、フッ素、塩素、臭素など)、ニトロ基などで置換されていてもよい。

カルボキシル基の保護基としては、例えばC,-。アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、tertーブチルなど)、フェニル基、シリル基、ペンジル基、アリル基などが用いられる。これらの基は1ないし3個のハロゲン原子(例えば、フッ素、塩素、臭素など)、ニトロ基などで置換されていてもよい。

ヒドロキシル基の保護基としては、例えばメトキシメチル基、アリル基、tert ープチル基、 C_{7-10} アラルキル基(例えば、ベンジルなど)、ホルミル基、 C_{1-6} アルキルカルボニル基(例えば、アセチル、エチルカルボニルなど)、ベンゾイル基、 C_{7-10} アラルキルカルボニル基(例えば、ベンジルカルボニルなど)、ピラニル基、フラニル基、トリアルキルシリル基などが用いられる。これらの基は、1ないし3個のハロゲン原子(例えば、フッ素、塩素、臭素など)、 C_{1-6} アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、tertーブチルなど)、フェニル基、 C_{7-10} アラルキル基(例えば、ベンジルなど)、ニトロ基などで置換されていてもよい。

これらの保護基の除去方法としては、自体公知またはこれに準じる方法が用いられるが、例えば酸、塩基、還元、紫外光、ヒドラジン、フェニルヒドラジン、Nーメチルジチオカルバミン酸ナトリウム、テトラブチルアンモニウムフルオリド、酢酸パラジウムなどを使用する方法などが用いられる。

前記本発明の各反応によって化合物が遊離の状態で得られる場合には、常法に従って塩に変換してもよく、また塩として得られる場合には、常法に従って遊離体またはその他の塩に変換することもできる。

かくして得られる本発明の化合物 (I) は、公知の手段、例えば転溶、濃縮、溶 媒抽出、分留、結晶化、再結晶、クロマトグラフィーなどにより反応溶媒から単離 て投与される。

本発明の医薬は化合物(I)の原末そのままであってもよいが、通常、薬学的に 許容しうる担体、希釈剤および増量剤など、例えば賦形剤(例えば、炭酸カルシウ ム、カオリン、炭酸水素ナトリウム、乳糖、D-マンニトール、澱粉類、結晶セル ロース、タルク、グラニュー糖、多孔性物質など)、結合剤(例えば、デキストリ ン、ゴム類、アルファ化澱粉、ゼラチン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロ キシプロピルメチルセルロース、プルランなど)、増粘剤(例えば、天然ガム類、 セルロース誘導体、アクリル酸誘導体など)、崩壊剤(例えば、カルボキシメチル セルロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、クロスポビドン、低置棒 度ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファ化澱粉など)、溶剤(例えば、注 10 射用水、アルコール、プロピレングリコール、マクロゴール、ゴマ油、トウモロコ シ油など)、分散剤(例えば、ツイーン80、HCO60、ポリエチレングリコー ル、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸ナトリウムなど)、 溶解補助剤(例 えば、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、D-マンニトール、安息 15 香酸ベンジル、エタノール、トリスアミノメタン、トリエタノールアミン、炭酸ナ トリウム、クエン酸ナトリウムなど)、懸濁化剤(例えば、ステアリルトリエタノ ールアミン、ラウリル硫酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、ポリビニルアルコ ール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシメチルセルロースなど)、無痛化剤(例 えば、ベンジルアルコールなど)、等張化剤(例えば、塩化ナトリウム、グリセリ ンなど)、緩衝剤(例えば、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩など)、滑沢 20 剤(例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、タルク、澱粉 、安息香酸ナトリウムなど)、着色剤(例えば、タール色素、カラメル、三二酸化 鉄、酸化チタン、リボフラビン類など)、矯味剤(例えば、甘味類、香料など)、 安定剤(例えば、亜硫酸ナトリウム、アスコルビン酸など)および保存剤(例えば 、パラベン類、ソルビン酸など)などの中から適宜、適量用いて、常法に従って調 25 製される。

前記薬学的に許容しうる担体、希釈剤、増量剤などを含んでいてもよい本発明の 医薬組成物は、本発明の化合物(I)を治療および予防するのに有効な量を含有す る。本発明の化合物(I)の本発明製剤中の含有量は、通常、製剤全体の約0.1

15

20

25

、精製することができる。

なお、本発明の化合物 (1) がジアステレオマー、コンフォーマーなどとして存在する場合には、所望により、通常の分離、精製手段によりそれぞれを単離することができる。また、本発明の化合物 (1) がラセミ体である場合には、通常の光学分割手段によりは体、1体に分離することができる。

本発明の化合物(1)は水に難溶性の対応する遊離アミノチアジアソリル化合物(すなわち、R'基がアミノ基を意味する)と比較して、水に対して大きな溶解性を有する特徴があり、かつR'なる基が生理条件で切断されて対応する遊離アミノチアジアゾリル化合物を生成し得るという長所を有する点で特徴を有する。さらに、遊離アミノチアジアゾール化合物を投与した場合よりも、優れた抗菌力を有しており、また、スペクトルの広い抗菌活性を有し、毒性が低いので人および哺乳動物(例、マウス、ラット、ウサギ、犬、ネコ、牛、豚等)における病原性細菌により生ずる種々の疾病、たとえば気道感染、尿路感染の予防ならびに治療のため安全に使用されうる。抗菌性化合物(1)の抗菌スペクトルの特徴としてつぎのような点が挙げられる。

- (1) 多種のグラム陰性菌に対して非常に高い活性を示す。
- (2) グラム陽性菌(たとえばスタフィロコッカス・アウレウス、コリネバクテリウム・ジフテリア工等)に対して高い活性を有している。
 - (3) メチシリン耐性ブドウ球菌 (MRSA) に対して高い活性を有している。
- (4) 多くのβーラクタマーゼ生産性グラム陰性菌(たとえばエシェリヒア属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属等)に対しても高い活性を有している。

また本発明の抗菌性化合物(I)は、優れた安定性を有するとともに、化合物(V)に比べて薬効の有効性が高いという特徴を有している。

本発明の化合物 (I) は公知のペニシリン剤、セフアロスポリン剤と同様に注射剤、カプセル剤、錠剤、顆粒剤として非経口または経口的に投与できる。特に注射剤として投与するのが好ましく、この場合その投与量はたとえば前記したような病原性細菌に感染した人および動物の体重 $1 \, \text{kg}$ あたり化合物 (I) として通常 $0.5 \, \text{cm}$ $0.5 \,$

よく、その他抗菌性化合物等が適宜、適量含まれていてもよい。

本発明はさらに下記の参考例、実施例で詳しく説明されるが、これらの例は単な る実例であって本発明を限定するものではなく、また本発明の範囲を逸脱しない範 囲で変化させてもよい。

実施例のカラムクロマトグラフィーにおける溶出はTLC (Thin Layer Chromatography、 薄層クロマトグラフィー)による観察下に行なわれた。TL C観察においては、TLCプレートとしてメルク (Merck) 社製の60F254 を、展開溶媒としてはカラムクロマトグラフィーで溶出溶媒として用いられた溶媒を、検出法としてUV検出器を採用した。カラム用シリカゲルは同じくメルク社製のキロゼルゲル60(70~230メッシュ)を用いた。ODS-AMはYMC株式会社製、Dowex50Wはダウケミカル社製、ダイアイオンHP-2OSSおよびSP-207は三菱化学社製である。NMRスペクトルは内部または外部基準としてテトラメチルシランを用いてGemini200型スペクトロメーターで測定し、全6値をppmで示した。混合溶媒において()内に示した数値は各溶媒の容量混合比である。また溶液における%は溶液100ml中のg数を表わす。また参考例、実施例中の記号は次のような意味である。

s :シングレット(singlet)

d ·ダブレット(doublet)

t :トリプレット(triplet)

q :クワルテット(quartet)

ABq :AB型クワルテット(AB type quartet)

dd :ダブル ダブレット(double doublet)

m :マルチプレット(multiplet)

bs :ブロード シングレット(broad singlet)

J :カップリング定数(coupling constant)

実施例 1

20

25

7 β - [2 (Z) -エトキシイミノ-2-(5-ホスホノアミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル) アセトアミド] - 3-[4-(1-メチル-4-ピリジニオ) - 2-チアゾリルチオ] - 3-セフェム-4-カルボキシレート

10

15

20

25

ないし約100重量%である。また、本発明で用いられる製剤は、本発明の化合物 (1) 以外の医薬成分 (例えば、以下に示される抗腫瘍剤など) を含有しでいても よく、これらの成分は本発明の目的が達成される限り特に限定されず、適宜適当な 配合割合で含有させて合剤とすることが可能である。剤型の具体例としては、例えば錠剤 (糖衣錠、フィルムコーティング錠を含む)、丸剤、カプセル剤(マイクロ カプセルを含む)、顆粒剤、細粒剤、散剤、点滴剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、注射剤、吸入剤、軟膏剤、座剤、トローチ剤、パップ剤、徐放剤などが用いられる。これらの製剤は常法 (例えば、日本薬局方第12改正に記載の方法など)に従って調製される。

特に、注射剤として用いられる場合の担体は、たとえば蒸留水、生理食塩水などが用いられ、カプセル剤、粉剤、顆粒剤、錠剤として用いられる場合は、公知の薬理学的に許容される賦形剤(たとえばデンプン、乳糖、白糖、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム等)、結合剤(たとえばデンプン、アラビアゴム、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース等)、滑沢剤(たとえばステアリン酸マグネシウム、タルク等)、破壊剤(たとえばカルボキシメチルカルシウム、タルク等)と混合して用いられる。

本発明の化合物(I) は公知のペニシリン剤,セフアロスポリン剤と同様に注射剤,カプセル剤,錠剤,顆粒剤(特に注射剤が好ましい)として非経口または経口的に投与できる。投与量は前記したような病原性細菌に感染した人および動物の体重1kgあたり化合物(I)として0.5~80mg/日,より好ましくは2~40mg/日を1日2~3回に分割して投与すればよい。注射剤として用いられる場合の担体は、たとえば蒸留水、生理食塩水などが用いられ、カプセル剤,粉剤,顆粒剤,錠剤として用いられる場合は、公知の薬理学的に許容される賦形剤(たとえばデンプン,乳糖,白糖,炭酸カルシウム,リン酸カルシウム等),結合剤(たとえばデンプン,アラビアゴム,カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース,結晶セルロース等),滑沢剤(たとえばステアリン酸マグネシウム、タルク等),破壊剤(たとえばカルボキシメチルカルシウム、タルク等)と混合して用いられる。なお、本願明細書において用いられている医薬組成物および抗菌組成物は、化合物(I)の単独であってもよく、上記したような担体などが含まれていても

計算値: C, 36, 66; H, 3, 50; N, 15, 55

実測値: C, 36.70; H, 3.94; N, 15.53

実施例3

7β - [2(Z) - 7) アルオロメトキシイミノー2 - (5 - ホスホノアミノー1.2 .4 - チアジアゾール -3 - イル) アセトアミド] -3 - [4 - (1 - メチル -45 -ピリジニオ)-2-チアゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルボキシレート 氷冷下、7 B-アミノー3-「4-(1-メチル-4-ピリジニオ)-2-チア ゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルボキシレート塩酸塩(1.42g)をテト ラヒドロフラン (50ml) と水 (50ml) 混合液に溶解し、0.6M炭酸水素 ナトリウム水溶液 1 2 m l を加え、p H を 7.5 に調整した。これに 2 - (5 - ジ 10 フルオロメトキシイミノアセチルクロリド3.41gを徐々に加え、0.6M炭酸 水素ナトリウム水溶液24mlでpH7.2~7.5を維持した。氷冷下で10分 間撹拌後、酢酸ナトリウム787mgを含む水20mlを加え、室温で3時間撹拌 した。1N塩酸3.4mlを加えて、pH3に調整後、減圧下で濃縮した。水0. 15 751で薄め、HP-20SSカラムクロマトグラフィー(500ml)に付した 。水1.51、10%エタノール水0.51、20%エタノール水1.51で溶出 し、標記化合物を含む画分を集め、減圧下で濃縮した。凍結乾燥して、粗製の標記 化合物を0.96 g得た。

20 NMR (D,0) δ : 3. 57, 3. 94 (2H, ABq, J=17. 4Hz), 4. 34 (3H, s), 5. 40 (1H, d, J=4. 8Hz), 5. 85 (2H, d, J=55Hz), 5. 93 (1H, d, J=4. 8Hz), 8. 34, 8. 72 (each 2H, d, J=6. 4Hz), 8. 51 (1H, s).

IR (KBr. cm⁻¹): 3055, 1781, 1677, 1642, 1523, 1364, 1189, 1071.

実施例4

25

 7β - [2(Z) - フルオロメトキシイミノ-2-(5-ホスホノアミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル) アセトアミド] - 3 - [4-(1-メチル-4-ピリジニオ) - 2-チアゾリルチオ] - 3 - セフェム-4-カルボキシレート

水冷下、 $7\beta-7$ ミノー $3-[4-(1-x+\mu-4-\nu]$ ジニオ) -2-4アゾリルチオ] $-3-\nu$ セフェム $-4-\mu$ ルボキシレート塩酸塩 (1,55g)・をテトラヒドロフラン (50m1) と水 (50m1) 混合液に溶解し、0.6M炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、pHを7.4に調整した。これに $2-(5-\nu)$ 0 ロロホスホリルアミノー $1,2,4-\mu$ 7ジアゾール $-3-\mu$ 7 $-2(2)-\mu$ 7 イミノアセチルクロリド3.69gを徐々に加え、0.6M炭酸水素ナトリウム水溶液でpH7. $2\sim7.3$ を維持した。水冷下で100 間撹拌後、酢酸ナトリウム861 mgを含む水10m1 を加え、室温で2.5時間撹拌した。 (pH4.5以上を維持、0.6M炭酸水素ナトリウム水溶液56m1 追加)1N塩酸4m1 を加えて、pH3 に調整後、減圧下で濃縮した。水0.81で薄め、10m10 に付した。水1.511 10m10 %エタノール水1.511 10m10 %エタイトル ※

NMR (D₂O) δ : 1. 33 (3H, t, J=7. 2Hz), 3. 56, 3. 9 4 (2H, ABq, J=17. 2Hz), 4. 34 (3H, s), 4. 35 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 38 (1H, d, J=5Hz), 5. 90 (1H, d, J=5Hz), 8. 34, 8. 72 (each 2H, d, J=6. 6Hz), 8. 51 (1H, s). IR (KBr, cm⁻¹): 3055, 1778, 1682, 1643, 1520, 1385, 1190, 1038.

20 実施例2

10

15

25

実施例1で得られた凍結乾燥品1.54gを炭酸水素ナトリウム378mgを含む水16mlに溶かし、ODS-AMカラムクロマトグラフィー(450ml)に付した。1N塩酸4.5ml、水1l、5%アセトニトリル水500ml、20%アセトニトリル水250mlで溶出した。標記化合物を含む画分を集め、減圧下で濃縮した。凍結乾燥して標記化合物を431mg得た。

元素分析値: C. H., N.O、PS, · 2. 0H.O

実施例 3 で得られた凍結乾燥品 0.96 g を炭酸水素ナトリウム 234 m g を含む水 15 m 1 に溶かし、ODS - AMカラムクロマトグラフィー。(450 m 1) に付した。1 N 塩酸 3.06 m 1、水 1 1、20% アセトニトリル水 250 m 1、30% アセトニトリル水 600 m 1 で溶出した。標記化合物を含む画分を集め、減圧

元素分析値: C., H., N.O. FPS, · 2. 0 H.O.

下で濃縮した。凍結乾燥して標記化合物を600mg得た。

計算値: C, 34.81; H, 3.06; N, 15.46; P, 4.27

実測値: C, 34.84; H, 3.28; N, 15.43; P, 4.18

実施例5

5

15

20

25

水冷下、 7β -アミノ-3- [4-(1-メチル-4-ピリジニオ)-2-チア ゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルポキシレート塩酸塩(3.0g)をテトラ

ヒドロフラン (150m1) と水 (150m1) 混合液に溶解し、0.6M炭酸水素ナトリウム水溶液 34m1 を加えた。これに2-(5-30m1) カロロホスホリルアミノー1, 2, 4-4 デジアゾールー3-4 ルクロリド4. 10 7 10 7 10 7 10 7 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 9

ウムでpHを5.0に調整し、滅圧下で濃縮した。水2.51で薄め、1N塩酸でpHを3.0に調整し、SP-207カラムクロマトグラフィー(750m1)に付した。水41、15%エタノール水61で溶出し、標記化合物を含む画分を集め、滅圧下で濃縮した。凍結乾燥して、粗製の標記化合物を2.6g得た。

NMR (DMSO-d₂) δ : 1. 23 (3H, t, J=7Hz), 3. 56, 3. 94 (2H, ABq, J=17Hz), 4. 17 (2H, q, J=7Hz), 4. 33 (3H, s), 5. 30 (1H, d, J=5Hz), 5. 90 (1H, dd, J=5Hz), 8. 8Hz), 8. 50, 8. 97 (each 2H, d, J=6. 4Hz), 8. 98 (1H, s), 9. 22 (1H, m), 9. 69 (1H, d, J=8. 8Hz).

実施例6

5 実施例5で得られた凍結乾燥品1.24gを氷冷下1N水酸化ナトリウム3.2 4mlを含む水13mlに溶かし、ODS-AMカラムクロマトグラフィー(450ml)に付し、水で溶出した。標記化合物のジナトリウム塩を含む画分を集め、Dowex50×8(H型)(20~50mesh、100ml)に付した。溶出液を減圧下で濃縮した。凍結乾燥して標記化合物を377mg得た。

10 元素分析値: C,,H,,N,O,PS,・3, 5H,O

計算値: C, 35.29; H, 3.77; N, 14.97

実測値: C, 35.26; H, 3.45; N, 14.99

. 94 (2H, ABq, J=17.6Hz), 4. 20 (2H, q, J=7Hz), 4. 33 (3H, s), 5. 30 (1H, d, J=5.2Hz), 5. 89 (1H, dd, J=5.2Hz\(2\)8. 6Hz), 8. 51, 8. 98 (each 2H, d, J=5.6Hz), 8. 98 (1H, s), 9. 17 (1H, m), 9. 69

NMR (DMSO-d₆) δ : 1. 24 (3H, t, J=7Hz), 3. 54, 3

(1H, d, J=8.6Hz).

実施例7

25

 $7\beta-$ アミノ-3-[4-(1-メチル-4-ピリジニオ)-2-チアゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルポキシレート塩酸塩(240mg)を塩化メチレン

た。水200mlで薄め、1N塩酸でpHを2. 8に調整し、SP-207カラムクロマトグラフィー(180ml)に付した。水500ml、15%エタノール水600mlで溶出し、標記化合物を含む画分を集め、減圧下で濃縮した。凍結乾燥して、粗製の標記化合物を100mg得た。

5 NMR (DMSO-d₆) δ:1. 23 (3H, t, J=7Hz), 3. 56, 3 . 94 (2H, ABq, J=17Hz), 4. 17 (2H, q, J=7Hz), 4 . 33 (3H, s), 5. 30 (1H, d, J=5Hz), 5. 90 (1H, dd , J=5Hz ≥ 8. 8Hz), 8. 50, 8. 97 (each 2H, d, J=6. 4Hz), 8. 98 (1H, s), 9. 22 (1H, m), 9. 69 (1H, d, J=6.

実施例8

実施例6で得られた7β-[2(Z)-エトキシイミノ-2-(5-ホスホノアミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)アセトアミド]-3-[4-(1-メチル-4-ピリジニオ)-2-チアゾリルチオ]-3-セフェム-4-カルボキシレートの凍結乾燥品(300mgカ価)に注射用生理食塩水を加え、pH6に調整し、投薬液5ml(60mgカ価/ml)を得た。

実験例1

30分後 35%

1時間後 62%

産業上の利用の可能性

本発明のセフェム化合物は (I) はグラム陰性菌並びにプドウ球菌およびMRS Aを含むグラム陽性菌に対して広範囲の抗菌スペクトルと優れた抗菌作用を有しており、これらの菌に基づく感染症にの治療および予防に有用である。

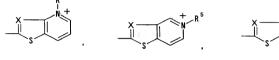
また、本発明の化合物 (I) は水に対する溶解性が比較的高く、特に注射剤などの製剤化において有利である。

15

清求の範囲

- 5 〔式中、 R^1 はホスフォノ基またはホスフォノ基に変じうる基を示し、 R^2 は水素原子または炭素原子を介して結合する基を、QおよびXはそれぞれ窒素原子またはC Hを示し、YはS 、OまたはC H_2 を示し、R はO または1 を示し、 R^3 および R^4 は一方が置換されていてもよいビリジニウム基を、他方が水素原子または置換されていてもよい炭化水素基を示すか、あるいは R^3 および R^4 は互いに結合して4級化した窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示す。1 で表される化合物またはそのエステルあるいはその塩。
 - 2. R'が保護されていてもよいホスフォノ基である請求項1記載の化合物。
 - 3. R'がホスフォノ、ジアルコキシホスフォリル、O-アルキルホスフォノ、ジアミノホスフォリル、(アミノ)(ヒドロキシ)ホスフォリル、(アルコキシ)(モルフォリノ)ホスフォリルまたはジハロホスフォリルである請求項1記載の化合物。
 - 4. R'がホスフォノである請求項1記載の化合物。
 - 5. YがSである請求項1記載の化合物。
 - 6. R^2 が置換されていてもよい C_{1-s} アルキル基または C_{3-s} シクロアルキル基である請求項1記載の化合物。
- 20 7. R*が置換されていてもよいピリジニウム基で、R*が水素原子である請求項1 記載の化合物。





〔式中、R⁶は置換されていてもよい炭化水素基を示す。〕で示される基である請求項1記載の化合物。

- 5 9. Qが窒素原子である請求項1記載の化合物。
 - 10. Xが窒素原子である請求項1記載の化合物。
 - 11. nが0である請求項1記載の化合物。

 - , 4-チアジアゾール-3-イル)アセトアミド]-3-[4-(1-メチル-4
- 10 ーピリジニオ) 2 チアソリルチオ] 3 セフェム 4 カルボキシレートまたはそのエステルあるいはその塩である請求項1記載の化合物。

 - -1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル) アセトアミド] -3-[4-(1-メ
 - チルー4 ピリジニオ) 2 チアゾリルチオ] 3 セフェム 4 カルボキシ
- 15 レートまたはそのエステルあるいはその塩である請求項1記載の化合物。

14. 式

$$\begin{array}{c|c}
NH_{2} & \\
0 & \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
COD^{-} \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH = CH \\
\end{array}$$

〔式中の記号は請求項1の記載と同意義を示す。〕で表される化合物またはそのエ ステルあるいはその塩と式

5 〔式中の記号は請求項1の記載と同意義を示す。〕で表されるカルボン酸またはその塩あるいは反応性誘導体とを反応させ、必要に応じてR¹をホスフォノ基に変換することを特徴とする請求項1記載の化合物の製造法。

15. 式

- 10 〔式中、R³′ およびR⁴′ は一方が置換されていてもよいピリジル基を、他方が水 素原子または置換されていてもよい炭化水素基を示すか、あるいはR³'およびR⁴' は互いに結合して窒素原子を含む置換されていてもよい複素環を示し、その他の記 号は請求項1の記載と同意義を示す。〕で表される化合物またはそのエステルある いはその塩を4級アンモニウム化反応に付し、必要によりR¹をホスフォノ基に変 換することを特徴とする請求項1記載の化合物の製造法。
 - 16. 請求項1記載の化合物を含有する医薬。
 - 17. 請求項1記載の化合物と薬理学的に許容しうる担体、希釈剤および増量剤の 少なくとも1つを含有する医薬。
 - 18. 抗菌組成物である請求項16記載の医薬。

- 19. 抗MRSA剤である請求項16記載の医薬。
- 20. 注射剤である請求項16記載の医薬。
- 21. 医薬の製造のための請求項1記載の化合物の使用。
- 22. 医薬が抗菌剤である請求項21記載の使用。
- 5 23. 医薬が抗MRSA剤である請求項21記載の使用。
 - 24. 医薬が注射剤である請求項21記載の使用。
 - 25. 請求項1記載の化合物の有効量を感染症患者に投与することを特徴とする感 染症を治療する方法。
 - 26. 請求項1記載の化合物の有効量と薬学的に許容しうる担体、希釈剤および増
- 10 量剤の少なくとも1つを感染症患者に投与することを特徴とする感染症を治療する方法。
 - 27. 感染症がMRSA感染症である請求項25記載の方法。
 - 28. 注射により投与する請求項25記載の方法。